Rec'd PCT/PTO 2 0 DE C 2004

PCT



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

P	ENT COOPERAT		TY PCT/DE2003/00 I
Anslation P	PCT	1	I ISSUE INTO ILLEADY
INTERNATIO	ONAL PRELIMINARY	EXAMINA	TION REPORT
	(PCT Article 36 and	d Rule 70)	
Applicant's or agent's file reference 26173	FOR FURTHER ACTION	See Notifice Preliminary E	ation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/DE2003/001827	International filing date (day/ 03 June 2003 (03.06		Priority date (day/month/year) 20 June 2002 (20.06.2002)
International Patent Classification (IPC) or n H01L 21/768	ational classification and IPC		
Applicant	INFINEON TECHNOL	OGIES AG	
This international preliminary examand is transmitted to the applicant a This REPORT consists of a total of	ccording to Article 36.		national Preliminary Examining Authority
amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	nied by ANNEXES, i.e., sheets or this report and/or sheets contended Administrative Instructions upon the contended of 6 sheets.	nder the PCT).	on, claims and/or drawings which have been ations made before this Authority (see Rule
IV Lack of unity of in V Reasoned stateme citations and expla VI Certain document.	t of opinion with regard to nove evention nt under Article 35(2) with reg anations supporting such staten	ard to novelty, i nent	atep and industrial applicability Inventive step or industrial applicability;
Date of submission of the demand	Da	te of completion	n of this report
19 January 2004 (19.	01.2004)	2	8 June 2004 (28.06.2004)
Name and mailing address of the IPEA/E	P Au	thorized officer	
Facsimile No.	Te	lephone No.	



Interna al application No.

PCT/DE2003/001827

1. Dasis of the report						
1. With regard to the elements of the international application:*						
	the inte	rnational application as originally filed				
\boxtimes	the des	cription:				
	pages	1-28	, as originally filed			
	pages		, filed with the demand			
	pages	, filed with the letter of	, mod mar and domain			
∇	Ala 1 . 1					
	the clai	ms:				
	pages		, as originally filed			
	pages	, as amended (together				
	pages	1-24 filed with the letter of	, filed with the demand			
	pages	, filed with the letter of	08 June 2004 (08.06.2004)			
\bowtie	the dra	wings:				
	pages	1/4-4/4	, as originally filed			
	pages		, filed with the demand			
	pages	, filed with the letter of				
	the seaue	nce listing part of the description:				
L	pages	•				
	pages		1			
	pages	, filed with the letter of	, filed with the demand			
2. With	regard t	o the language, all the elements marked above were available or furnished to the nal application was filed, unless otherwise indicated under this item.	is Authority in the language in which			
Thes	e elemen		which is:			
	the lan	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Ru	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	,			
		guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary	examination (under Rule 55.2 and/			
	or 55.3).				
3. With preli	n regard minary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internat xamination was carried out on the basis of the sequence listing:	ional application, the international			
	contair	ained in the international application in written form.				
		ogether with the international application in computer readable form.				
		shed subsequently to this Authority in written form.				
		ed subsequently to this Authority in computer readable form.	j			
	The st	atement that the subsequently furnished written sequence listing does not tional application as filed has been furnished.	go beyond the disclosure in the			
	The st	atement that the information recorded in computer readable form is identical amished.	to the written sequence listing has			
,						
4		nendments have resulted in the cancellation of:	i			
		the description, pages	.			
		the claims, Nos.	ţ			
		the drawings, sheets/fig				
5.	This rep	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, single the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	nce they have been considered to go			
and i	acement : is report 70.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invita as "originally filed" and are not annexed to this report since they do no	t contain amendments (Rule 70.16			
TT Any I	** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.					

INTERNATIONAL PRELIMINARY MINATION REPORT

International	applicat	ion No.
PCT/DE	0	1827

	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
₹.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to hoverty, inventive 357
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1, 17	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1, 17	YES
inventive step (13)	Claims		NO NO	
	Industrial applicability (IA)	Claims	1, 17	YES
	mountain approximity (==)	Claims		NO NO
1				

Citations and explanations 2.

WO-A-0 219 420 (D1), which is considered to represent the closest prior art, discloses (see, in particular, abstract; page 9, line 8 to page 10, line 19; page 23, line 4 to page 26, line 4; and figures 1 and 2) a substrate having a layered arrangement and a process from which the subject matter of claims 1 and 17 differs in that an electrically conductive passivation layer is provided at least between the useful structure and the top layer.

The subject matter of claims 1 and 17 is therefore novel (PCT Article 33(2)).

The problem addressed by the present invention may therefore be considered that of providing a barrier to prevent the diffusion of material from the useful structure in order to increase freedom of choice with respect to the material forming the top layer.

The solution to this problem proposed in claims 1 and 17 of the present application involves an inventive step (PCT Article 33(3)). The reasons are:

Although the feature of a passivation layer at least

between the useful structure and the top layer has been used in a similar layered arrangement (cf. US-A-2002/0016058, in particular paragraph [0040]), this document proposes an electrically insulating layer.

The proposal made in US-A-2002/0016058 therefore does not correspond to the distinguishing feature of claims 1 and 17, in which an electrically conductive passivation layer is required.

Use of an electrically conductive passivation layer has the additional effect that sheathing the useful structure with an electrically insulating material, which would be inimical to the aim of forming a "low-k" structure, is thus avoided.

The general observation made in D1 (page 10, lines 13-19) that layers could consist of multiple sublayers cannot suggest the specific teaching of an electrically conductive passivation layer at least between the useful structure and the top layer.

Rec'd PCT/PTO 2 0 DEC 2004

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM REC'D 2 \$ JUN 2004

PCT

REC'D 2 9 JUN 2004

WIPO PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

26	173		es Anmelders oder Anwalts	WEITERES VO	RGEHEN	siehe Mitteilung vorläufigen Prü	g über die Übersendung des interr ifungsberichts (Formblatt PCT/IPE	nationalen A/416)
PC				Internationales Anme 03.06.2003		Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr 20.06.2002)
HO	1L21	/768 	atentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation	und IPK			
1	ielder INE		ECHNOLOGIES AG et	al.			·	
1.	Die bea	ser in auftrag	ternationale vorläufige Pri gten Behörde erstellt und v	ifungsbericht wurde wird dem Anmelder (von der m gemäß Arti	it der internatio kel 36 übermitt	nalen vorläufigen Prüfung elt.	
2.	Die	ser Bl	ERICHT umfaßt insgesam	t 5 Blätter einschlie	Blich diese	s Deckblatts.	·	,
	☒	Auß und Beh PCT	Berdem liegen dem Berich Joder Zeichnungen, die ge Jörde vorgenommenen Be ().	t ANLAGEN bei; dal eändert wurden und richtigungen (siehe	pei handelt diesem Be Regel 70.1	es sich um Blä richt zugrunde 6 und Abschnit	itter mit Beschreibungen, Ansp liegen, und/oder Blätter mit vo t 607 der Verwaltungsrichtlinie	rüchen dieser en zum
	Die	se Anl	agen umfassen insgesam	t 6 Blätter.				
3.	Dies	er Be	richt enthält Angaben zu f	olgenden Punkten:				
	1	\boxtimes	Grundlage des Bescheid	ds				
	11		Priorität					
	{ }		Keine Erstellung eines G	autachtens über Neu	heit, erfind	lerische Tätiake	eit und gewerbliche Anwendba	rkoit
	IV		wangeinde Einneitlichke	eit der Erfindung				
	V	×	Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	nach Regel 66.2 a) rkeit; Unterlagen un	ii) hinsichtli d Erklärun	ich der Neuheit gen zur Stützun	, der erfinderischen Tätigkeit u	nd der
	VI		Bestimmte angeführte U	nterlagen		5 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -	g diodoi i colotellalig	
	VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung							
	VIII	Ц	Bestimmte Bemerkunger	n zur internationalen	Anmeldun	g		i
Datum	Datum der Einrelchung des Antrags Datum der Fertigstellung dieses Berichts							
19.01	9.01.2004			28.06.2004				
Name beauffr	ame und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung eauftragten Behörde			Bevolimäd	chtigter Bedienste	eter		
	Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465			Schreib	er, M	· James		
					Tel. +49 8	9 2399-2831	2 Angorna	eamo . omes

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01827

. Grund	lage d	es B	erichts
---------	--------	------	---------

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	В	Beschreibung, Seiten					
	1.	-28	in der ursprünglich eingereichten Fassung				
	A	nsprüche, Nr.					
	1-	-24	eingegangen am 08.06.2004 mit Schreiben vom 08.06.2004				
	Ze	eichnungen, Blätter					
	1/4	4-4/4	in der ursprünglich eingereichten Fassung				
 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprac die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereich unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 							
	Die eir	e Bestandteile stande ngereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache lelt es sich um:				
		die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).					
		die Veröffentlichun	gssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).				
		die Sprache der Üb	persetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht egel 55.2 und/oder 55.3).				
3.	Hin inte	nsichtlich der in der ir ernationale vorläufige	nternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:				
		in der internationale	en Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.				
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde na	chträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde na	pei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		Die Erklärung, daß i	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.				
		Die Erklärung, daß	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen ntsprechen, wurde vorgelegt.				
4.	Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:						
		Beschreibung,	Seiten:				
		Ansprüche,	Nr.:				
		Zeichnungen,	Blatt:				
			·				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01827

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1,17

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1,17

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1,17

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Dokument WO-A-0 219 420 (= Dokument D1), das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (siehe insbesondere die Zusammenfassung, Seite 9, Zeile 8 - Seite 10, Zeile 19, Seite 23, Zeile 4 - Seite 26, Zeile 4 und Fig. 1 und 2) ein Substrat mit einer Schicht-Anordnung und ein Verfahren, von denen sich der Gegenstand der Ansprüche 1 und 17 durch

eine elektrisch leitfähige Passivierungsschicht zumindest zwischen der Nutzstruktur und der Deckschicht unterscheidet.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 17 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, eine Diffusionsbarriere zum Vermeiden des Ausdiffundierens von Material der Nutzstruktur zu schaffen, um die Wahlfreiheit hinsichtlich des Materials der Deckschicht zu erhöhen.

Die in den Ansprüchen 1 und 17 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

Das Merkmal einer Passivierungsschicht zumindest zwischen der Nutzstruktur und der Deckschicht wurde zwar schon bei einer ähnlichen Schicht-Anordnung benutzt, vgl. dazu Dokument US-A-2002/0016058, insbesondere Absatz [0040]. Jedoch schlägt dieses Dokument eine elektrisch isolierende Schicht vor.

Der in diesem Dokument gemachte Vorschlag entspricht daher nicht dem unterscheidenden Merkmal der Ansprüche 1 und 17, in denen eine elektrisch leitfähige Passivierungsschicht gefordert wird.

Das Verwenden einer elektrisch leitfähigen Passivierungsschicht hat die zusätzliche Wirkung, dass dadurch eine Ummantelung der Nutzstruktur mit einem elektrisch isolierenden Material vermieden wird, was dem Ziel des Bildens einer "low-k-Struktur" entgegenwirken würde.

Auch die in Dokument D1 auf Seite 10, Zeilen 13 - 19 gemachte allgemeine





Internationales Aktenzeichen PCT/DE03/01827

Bemerkung, dass Schichten aus mehreren Teilschichten bestehen könnten, kann die spezifische Lehre einer elektrisch leitfähigen Passivierungsschicht zumindest zwischen der Nutzstruktur und der Deckschicht nicht nahelegen.





Patentansprüche:

- 1. Schicht-Anordnung
- mit einem Substrat;
- mit einer auf dem Substrat angeordneten Schicht, die einen ersten Teilbereich aus zersetzbarem Material und einen daneben angeordneten zweiten Teilbereich mit einer Nutzstruktur aus einem nicht-zersetzbaren Material aufweist;
- mit einer Deckschicht auf der Schicht aus zersetzbarem Material und der Nutzstruktur;
- mit einer elektrisch leitfähigen Passivierungsschicht zumindest zwischen der Nutzstruktur und der Deckschicht;
- wobei die Schicht-Anordnung derart eingerichtet ist, dass das zersetzbare Material aus der Schicht-Anordnung mittels Diffundierens durch die Deckschicht hindurch entfernbar ist.
- 2. Schicht-Anordnung nach Anspruch 1 mit einer Zwischenschicht zwischen dem Substrat und der Schicht aus zersetzbarem Material und aus der Nutzstruktur.
- 3. Schicht-Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 bei der das Substrat Silizium aufweist.
- 4. Schicht-Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, bei der die Deckschicht und/oder die Zwischenschicht aus dielektrischen Material hergestellt ist.
- 5. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, bei der die Deckschicht und/oder die Zwischenschicht aus einem oder einer Kombination der Materialien
- Siliziumoxid;
- Siliziumnitrid;
- SiLK;
- poröses SiLK;
- Oxazol;
- poröses Oxazol;





- Black Diamond;
- Coral;
- Nanoglass;
- JSR LKD;
- Polybenzoxazol;
- Polybenzimidazol;
- Polyimid;
- Polychinolin;
- Polychinoxalin;
- Polyarylen; und
- Polyarylenether

ist.

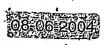
- 6. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der die Deckschicht derart eingerichtet ist, dass sie für zersetztes zersetzbares Material durchlässig ist.
- 7. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der die Nutzstruktur aus einem elektrisch leitfähigen Material hergestellt ist.
- 8. Schicht-Anordnung nach Anspruch 7, bei der die Nutzstruktur
- Silber;
- eine Silber-Legierung;
- Wolfram;
- Wolfram-Silizid;
- Aluminium;
- eine Aluminium-Legierung;
- Kupfer; und/oder
- eine Kupfer-Legierung aufweist.
- 9. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der die Nutzstruktur aus einem dielektrischen Material hergestellt ist.
- 10. Schicht-Anordnung nach Anspruch 9,





bei der die Nutzstruktur

- Siliziumdioxid;
- Siliziumnitrid; und/oder
- ein keramisches Material aufweist.
- 11. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei der das zersetzbare Material thermisch zersetzbar ist.
- 12. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei der das zersetzbare Material eines oder eine Kombination von
- Polyester;
- Polyether;
- Polyethylenglykol;
- Polypropylenglykol;
- Polyethýlenoxid;
- Polypropylenoxid;
- Polyacrylat;
- Polymethacrylat;
- Polyacetal;
- Polyketal;
- Polycarbonat;
- Polyurethan;
- Polyetherketon;
- cycloaliphatischem Polymer;
- Polynorbornen;
- aliphatischem Polyamid;
- Novolak;
- Polyvinylphenol;
- eine Epoxy-Verbindung;
- Co-Polymer dieser Verbindungen; und
- Ter-Polymer dieser Verbindungen aufweist.
- 13. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei der das zersetzbare Material photosensitiv ist.





- 14. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei der in der zwischen dem Substrat und der Deckschicht angeordneten Schicht mindestens eine Stützstruktur ausgebildet ist.
- 15. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14 mit einer entlang der seitlichen Begrenzung des Substrats verlaufenden Schutzstruktur zum Schutz der Nutzstruktur vor Einflüssen der Umgebung.
- 16. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 15 mit einer die Nutzstruktur zumindest teilweise umgebenden Passivierungsschicht.
- 17. Verfahren zum Herstellen einer Schicht-Anordnung bei dem
- auf einem Substrat eine Schicht ausgebildet wird, die einen ersten Teilbereich aus zersetzbarem Material und einen daneben angeordneten zweiten Teilbereich mit einer Nutzstruktur aus einem nicht-zersetzbaren Material aufweist;
- eine Deckschicht auf der Schicht aus zersetzbarem Material und der Nutzstruktur ausgebildet wird;
- eine elektrisch leitfähige Passivierungsschicht zumindest zwischen der Nutzstruktur und der Deckschicht gebildet wird;
- wobei die Schicht-Anordnung derart eingerichtet ist, dass das zersetzbare Material aus der Schicht-Anordnung mittels Diffundierens durch die Deckschicht hindurch entfernbar ist.
- 18. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem das zersetzbare Material aus der Schicht-Anordnung entfernt wird.
- 19. Verfahren nach Anspruch 18, bei dem das zersetzbare Material mittels thermischen Zersetzens aus der Schicht-Anordnung entfernt wird.





- 20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19, bei dem
- die Nutzstruktur aus Kupfer ausgebildet wird;
- die Nutzstruktur zumindest teilweise mit einer Passivierungsschicht ummantelt wird, welche
 Passivierungsschicht
 - o mittels eines "Electroless Deposition"-Verfahrens aus Kobalt-Wolfram-Phosphor, Kobalt-Wolfram-Bor, Kobalt-Phosphor oder Ruthenium ausgebildet wird; oder
 - o mittels eines "Chemical Vapour Deposition"Verfahrens aus Tantal, Tantalnitrid, Titannitrid,
 Wolfram, Wolfram-Stickstoff oder Wolfram-Kohlenstoff
 ausgebildet wird.
- 21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20, bei dem die Schicht aus zersetzbarem Material und der Nutzstruktur ausgebildet wird, indem
- zersetzbares Material abgeschieden und strukturiert wird;
- Material der Nutzstruktur abgeschieden wird;
- die Oberfläche der so erhaltenen Schichtenfolge planarisiert wird.
- 22. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20, bei dem die Schicht aus zersetzbarem Material und der Nutzstruktur ausgebildet wird, indem
- Material der Nutzstruktur abgeschieden und strukturiert wird;
- zersetzbares Material abgeschieden wird;
- die Oberfläche der so erhaltenen Schichtenfolge planarisiert wird.
- 23. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22, bei dem mindestens ein zusätzlicher Schichtenstapel auf der Deckschicht ausgebildet wird, wobei der zusätzliche Schichtenstapel eine zusätzliche Deckschicht auf einer zusätzlichen Schicht aus zersetzbarem Material und einer





Nutzstruktur aufweist.

24. Verfahren nach Anspruch 23, bei dem durch eine Deckschicht voneinander getrennte Nutzstrukturen miteinander gekoppelt werden, indem in die Deckschicht mindestens ein Kontaktloch eingebracht und mit elektrisch leitfähigem Material gefüllt wird.